

Japanese Patent Application Publication (JP-B) No.54-25957

Publication Date: August 31, 1979

Application No.: 51-9947

Application Date: January 31, 1976

TITLE: POLYMERS FOR AQUEOUS PROCESSED PHOTORESISTS

Applicant: Dynachem Corporation, Santa Ana, Calif.

Abstract:

A new photopolymerizable composition which contains an addition polymerizable monomer, a photoinitiator, and an improved binding agent which is a polymer of three types of monomeric materials, namely, a styrene-type monomer, an acrylate monomer, and an alpha, beta-unsaturated carboxyl-containing monomer. These compositions are useful for flexible photopolymerizable films which, after exposure, may be developed in aqueous alkaline solutions. These films may be used as photo-resists, screen stencils and printing plates.

⑫特許公報(B2)

昭54-25957

⑬Int.Cl. ²	識別記号	⑬日本分類	庁内整理番号	⑭公告 昭和54年(1979)8月31日
C 08 F 2/50		26(3)B 0	6358-4 J	
C 08 F 2/44//		26(3)A 22		発明の数 1
G 03 C 1/68		26(3)A 103	6791-2 H	
G 03 F 7/10		116 A 415	7267-2 H	
H 05 K 3/06		103 B 0	7638-5 F	(全 12 頁)
		59 G 416		

1

2

⑭光重合性組成物およびその製法

⑮特 願 昭51-9947

⑯出 願 昭51(1976)1月31日

公 開 昭52-94388

⑰昭52(1977)8月8日

⑱発 明 者 メルヴィン・エイ・リブソン

アメリカ合衆国カリフォルニア州

92632フアラートン・アルテ

イヴォ・ブレース2829

同

ユージン・ザドーア

アメリカ合衆国カリフォルニア州

92633フアラートン・ミラダ

1609エイ・グイア

⑲出 願 人 ダイナケム・コーポレーション 15

アメリカ合衆国カリフォルニア州

92680タステイン・ミツエ

ル・ドライブ2632

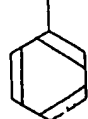
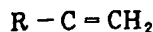
⑳代 理 人 弁理士 中村 稔 外1名

㉑特許請求の範囲

1 (A) 100℃より高い沸点を有する1またはそれ以上の非ガス状化合物より本質的に成る附加重合物質 10~60重量部;

(B) 光により開始される遊離基発生附加重合開始系;および

(C) 一般式



(但し、式中、

Rは水素、1~6個の炭素原子を有するアルキル基またはハロ基を示す)

を有する群から選ばれた1またはそれ以上のステレン型化合物またはその環置換誘導体を含有する第1重合性物質 40~60%;

アルキル基が1~6個の炭素原子を有し、ヒドロキシアルキル基が2~6個の炭素原子を有するアルキルアクリレート、アルキルメタクリレート、ヒドロキシアクリルアクリレート、またはヒドロキシアクリルアクリレートより成る群から選ばれる1またはそれ以上の化合物を含有する第2重合性物質 15~45%;

3~15個の炭素原子を有する1またはそれ以上のα・β-不飽和カルボキシル基含有モノマーを含有する第3重合性物質 15~40%;

の重合体であつて、40%溶液になる様にメチルエチルケトンに溶解した場合に、ブルックフィールド粘度計で少くとも2000センチポイズの粘度を有する予備成形された高分子重合結合剤 40~90重量部

20 より成り、pH 9乃至14のアルカリ水溶液に可溶であり、1ミル厚のフィルムにおいて10~2.0のスワード硬度、2ミル厚のフィルムにおいて8~14のスワード硬度を有することを特徴とする光重合性組成物。

25 2 予備成形された高分子重合結合剤が

40~60% ステレン;

15~45% メチルメタアクリレートとエチルアクリレートより成るアクリレート成分;

15~40% メタクリル酸

の共重合体である特許請求の範囲第1項に記載の共重合性組成物。

35 3 予備成形された高分子重合結合剤のメチルエチルケトン中40%溶液が2500~8000セ

3

ンチボイズの粘度を有する特許請求の範囲第1項に記載の組成物。

4 予備成形された重合結合剤が、

45～55%の第1単量体物質；

25～35%の第2単量体物質；および

18～30%の第3単量体物質

の重合体である特許請求の範囲第1項に記載の組成物。

発明の詳細な説明

本発明は、新規な光重合性組成物およびその使用法に関し、更に詳しくは、アルカリ水溶液によつて現像でき、しかもその水溶液から可撓性フィルムを生ずる感光性組成物に関する。

かかる感光性組成物から形成されるフォトレジストは、通常に使用されているメッキ液やエッチング液に対して耐性があるから、プリント回路用フォトレジストとして用いられ、またスクリーンステンシルや印刷板の成形材料としても有用である。

有機溶媒は一般にコストが高く、毒性があり、かつ可燃性でもある。その上、空気や水を汚染するという欠点をも有している。そのためかかる有機溶媒を使用しないで現像できる感光性組成物を得ることが長い間熱望されて来た。かかる有機溶媒を使用しないで、アルカリ水溶液で現像される系が英国特許第1361298号に記載されている。この英国特許第1361298号に記載されている組成物は企図された目的には非常に有用であるが、それを乾燥したフィルム積層体として用いたときに極めて可撓性に欠けるという欠点を有している。脆いフィルムは使用中または使用前にクラックを生ずるばかりでなく、使用者がマスターロールを所望のサイズに切断する時に適度にスリットし損うという欠点を有する。また、スリットロールの端にはスライバーが形成され、光重合性組成物層を、基体であるポリエステル層から分離させる欠点をもつ。この現象の起る領域では光重合性組成物層に適度の感光が起らず、現像後のレジストとしての機能を失う。このように脆いフィルムは、たとえそれが回路板として使用されても回路板を折り曲げた時にクラックが起きたり、またフィルムが回路板から剝離したりするため可撓性の回路設計には役立たない。

従来公知の手段として可撓性を改良するため外

4

部可塑剤を混入する例がある。しかしながらこの方法によつては可塑剤が時間と共にミグレイションを起こしたり、ひどいコールドフローを起こしたりして必ずしも満足のゆくものでなかつた。特にコールドフローは、フィルムのロールが静的負荷の状態に置かれるため短時間で、光重合性物質を層間からにじみ出し始めるから、耐え難い欠点となつている。このにじみ出た物質がロールの端で融け、不可能といわぬまでも均一にしかも対向するフィルムを損うことなくロールからはぐすことを困難にするということである。また、前記外部可塑剤を含む組成物からフィルムを製造するに当つては、乾燥を正確にコントロールしないと、可塑剤が蒸発してしまいもとの脆い状態のフィルムになつてしまう。

本発明は、乾燥フィルムであつても外部可塑剤なしで良好な可撓性を示すと同時に高い耐コールドフロー性を有する水で現像される光重合性組成物を発見したことにある。その上、この組成物を露光して重合体に変性した個所は、プリント回路や化学的機械部品の製造に当つて使用される典型的な溶液—アルカリ性エッチング剤やアルカリ性メッキ液等—に対して著しい耐性を示す。

要するに、本発明の利点は、(1)スチレン型モノマー、(2)アクリレート型モノマー、および(3)不飽和カルボキシル基含有モノマーからなる共重合体を適合する巨大分子の高分子結合剤として選定したことにある。第1の成分は、重合体に固さと耐化学薬品性を付与し、第2の成分は重合体の骨格に可撓性と可塑性とを付与し、第3の成分はアルカリ可溶性を付与する。

本発明の光重合性組成物は、(1)10～60重量部の通常の附加重合性で非ガス状のエチレン性不飽和化合物と、(2)40～90重量部の前記結合剤と(3)1～10重量部の通常のフリーラジカル光重合開始剤とから構成される。通常の熱附加重合禁止剤も、5重量部まで、好ましくは0.005～2.0重量部まで加えてよい。さらに前記組成物には、染料や顔料、その他光重合性組成物の物理的・化学的性質を向上させるのに役立つ。例えば可塑剤、接着促進剤等の添加物を添加してもよい。

エチレン性不飽和化合物は、少なくとも1つの末端エチレン基($\text{CH}_2=\text{C}$)を有し、かつ大

5

気圧下で100℃以上の沸点を有し、その上フリースラジカル光重合的開始剤による連鎖重合反応で高分子量の重合体を形成するものでなければならない。このような化合物は、米国特許第2760863号に開示されている。

この化合物としては、常温で液体または固体であつて1~4またはそれ以上の、好ましくは2個またはそれより多くの末端エチレン基を有し、かつ熱可塑性重合性結合剤に可塑性剤的作用を有するものが望ましい。好ましい化合物としては、炭素原子数2~15のアルキレングリコールまたは1~10のエーテル結合を有するポリアルキレンエーテルグリコールから合成されたアルキレンまたはポリアルキレングリコールジアクリレートが挙げられる。これらは単独ではまた混合物としても使用できる。

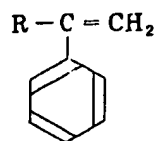
露光によつて不溶性になる速さ、これは多分、高分子の急速な網目構造になることに因ると考えられるが、低分子量の付加重合性成分のうち、付加重合性エチレン結合を有する成分、特にこのエチレン結合が末端にある化合物、少なくとも前記結合の1つが二重結合性の炭素、即ち炭素炭素二重結合、窒素、酸素、イオウ等のヘテロ原子と二重結合を形成するような炭素と共役して存在する残基を有する成分が最も優れている。これらの化合物として、エチレン性不飽和基とくにビニリデン基がエステルまたはアミド構造と共役しているものがよい。次に、特定する化合物はこれらの群の化合物をさらに説明するためのものである。ポリオールの不飽和エステル、特にメチレンカルボン酸のエステル、例えば、エチレンジアクリレート；ジエチレングリコールジアクリレート；テトラエチレングリコールジアクリレート；グリセリンジアクリレート；トリメチロールプロパントリアクリレート；グリセリントリアクリレート；エチレンジメタクリレート；1・3-プロピレンジメタクリレート；1・2・4-ブタントリオールトリメタクリレート；1・4-ベンゼンジオールジメタクリレート；ペンタエリトリールテトラメタクリレート；1・3-プロパンジオールジアクリレート；1・5-ペンタンジオールジメタクリレート；ビス4・4'-(2-ヒドロキシエチル)フエニル-2・2'-プロパン等のポリエチレングリコールとエトキシ化アルコールとフエノ

6

ールとからなるビス-アクリレートまたはビスメタクリレート；不飽和アミド、特にメチレンカルボン酸や、メチレンビスアクリルアミド；メチレンビス-メタクリルアミド；1・6-ヘキサメチレンビス-アクリルアミド；ジエチレントリアミントリス-メタクリルアミド；ビス(メタクリルアミドプロポキシ)エタン； β -メタクリルアミドエチルメタクリレート；N-[(β -ヒドロキシ-エチルオキシ)エチル]アクリルアミド等の α - Ω -ジアミンおよび酸素原子介在の Ω -ジアミン類のアミド；ジビニルサクシネート、ジビニルアジペート、ジビニルフタレート、ジビニルテレフタレート、ジビニルベンゼン-1・3-ジスルホネート、ジビニルブタン-1・4-ジスルホネート等のビニルエステル；ソルブアルデヒド(ヘキサジエナール)等の不飽和アルデヒド。

好ましい単量体は二官能性または多官能性の単量体であるが、単官能性の単量体も使用できる。加えるべき単量体の量は、特定する熱可塑性重合体によつて変えられる。

重合性結合剤のステレン型成分は、一般式



(式中、Rは水素、炭素原子数1~6のアルキル基またはハロゲンである)で表わされる化合物である。ベンゼン環は、ニトロ基、アルコキシ基、アシル基、カルボキシ基、スルホ基、ヒドロキシ基またはハロゲン等の官能基で置換されてもよい。ベンゼン核の置換残基は1~5の範囲であつてよい。好ましい置換基としては、メチルまたは α -ブチル基等の単一のアルキル基である。上述の化合物のうち最も好ましい化合物は、ステレン α -メチルスチレン、パラメチルスチレンおよびパラ α -ブチルスチレンである。

アクリレート型成分は、炭素原子数1~12、好ましくは1~6のアルキル基を有するアルキルヒドロキシアクリレート、またはアルキルヒドロキシアクリルメタクリレートである。これらの化合物の例として、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、ヒドロキシプロピルメ

7

タクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレートおよびヒドロキシエチルアクリレートがある。またこれらの化合物2種またはそれ以上のものの混合物も用いられる。

第3共単量体としては、炭素原子数3~15、好ましくは3~6の不飽和カルボキシル基含有単量体の1またはそれ以上が挙げられる。最も好ましい化合物としては、アクリル酸およびメタクリル酸がある。使用し得る他の酸としては、ケイ皮酸、クロトン酸、ソルビン酸、イタコン酸、プロピオール酸、マレイン酸およびフマル酸がある。またこれらの半エステル類または無水物も可能である。結合剤中の3成分の割合は、その結合剤を混入する光重合性組成物が次の各性質をもつように選択されねばならない。即ち、第1に、光重合性組成物は、可撓性があり、かつ固くなければならない。ただし粘着性があつてはならない。第2に、未露光光重合性物質は、pH 9~14のアルカリ水溶液中で現像されなければならない；第3に光重合性物質は、穏和なアルカリ水溶液ないしはエッチング剤（pH 約8.5のピロリン酸銅メツキ浴）に対して耐性がなければならない；第4に、結合剤の40%メチルエチルケトン溶液の粘度は、少なくとも2000センチポイズでなければならない。この粘度の好ましい範囲は、2500~8000センチポイズである。粘度の測定は、いづれもブルツクフィールドの粘度計による。

結合剤を合成するのに使用される単量体の3成分の重量割合を次表に示す。

結合剤成分	広い範囲	好適範囲
スチレン型	40~60%	45~55%
アクリレート基	15~45%	25~35%
カルボン酸基	15~40%	18~30%

乾燥フィルムを実験室的に製造するに当つての塗布および乾燥法として次のものがある。即ち、メチルエチルケトン溶液にすべての成分を混入し攪拌して塗布溶液を作る。この溶液をさらにケトン溶液で希釈して、粘度を100~200センチポイズにする。この塗液を、強化ガラス上に伸ばした長さ10フィート、幅5センチのポリエステル膜上に塗布する。均一な薄い塗膜は、メイヤーロ

8

ッドないしはガードナードクターナイフを用いて形成する。厚さは、乾燥後1ないし2ミルの厚さのフィルムになるように調整する。

乾燥は、例えば150ワットのドライヤーを用いて行なう。ドライヤーは、全乾燥を行い得る実験室規模のトンネルの一方の端に置かれる。熱風を20分間継続的に送風し、残存溶媒の量が約0.1~2%になるまでフィルムを乾燥する。この程度の残存溶媒量では、乾燥フィルムレジストの化学的、物理的特性を害することはない。

乾燥フィルムの可撓性は、そのフィルムをしわくちやに丸め、次いで引き伸ばすことによつて測る。こうした数多くの折りたたみを積み重ねると脆いフィルムであれば、クラックないしは剝離が起る。他方、可撓性のフィルムであれば、連続したシート状態で残る。

可撓性と乾燥の寛容度とは、試料フィルムを強制対流炉中で82℃（180°F）、10分間過剰乾燥する試験法によつても調べられる。勿論、過剰乾燥した試料は、上述の試験法に供される。薄い1、2ミル程度の非支持光重合体フィルムのコールドフロー性についての工業的測定法は、フィルム自体の性癖もあつて確定したものは認められていない。最もよい方法は、現実に2ミルの光重合性フィルムを少なくとも152メートル（500フィート）、通常の張力下で芯に捲き、そのフィルムを相当の期間室温下で端で立てて置くことである。良好なフィルムであれば、6ヶ月間18°~24℃（65°~75°F）であつても端に溶融の現象が起らない。

前述の経験的なコールドフロー測定法と密接な関係を有する2つの定性的な測定法がある。その1つはスウオード硬度法であり、他の1つは“真空下のコールドフロー”法（cold-flow-under-vacuum）である。

スウオード硬度指数は、試料フィルムの表面硬度と標準ガラスの表面硬度の比で表わされる。スウオードロッカーは最初ガラスに対する読み100を目盛り、次いで同一ガラスシート上に積層した試料フィルムの読みを計る。良好な1ミルの水で現像できるフィルムのスウオード硬度は10~20であり、また2ミルフィルムのそれは8~14である。

静的負荷としての真空下コールドフロー法にお

11

(C.I.19300);パフアローブラック
10B(C.I.27790);ナフタレンブラッ
ク12R(C.I.20350);ファーストブラ
ックL(C.I.51215);エチルバイオレ
ット(C.I.42600);ポンタシルウール
ブルーBL(C.I.50305);ポンタシルウ
ールブルーGL(C.I.52320);(カラー
インデックス第2版による)。

光重合可能な要素は、化学的に活性な放射線に
露光される。この露光は、ハーフトーン像または
プロセス透明度、例えばプロセス陰面または陽面
ステンシルないしはマスクを通して行なわれる。
露光はまた連続トーンの陰面または陽面を通して
行なつてもよい。露光は、光重合性層にカパー
シートを設けまたは設けずに接触法ないしは投影法
で行なつてもよいし、カパーシートを用いる投影
でもよい。これらの方法は、当業界の専門家には
明白なものである。

フリーラジカルを発生する付加重合開始剤は、
化学的放射線(活性放射線)で活性化されるが、
その感受性は、紫外線領域において最大である。
その故に放射線源は、この紫外線を有効に放射す
るものにすべきである。点または広域放射線源が
有効である。こうした放射線源としては、カーボ
ンアーク、水銀蒸気アーク、紫外線放射性螢光体
を設けた螢光灯、アルゴングローランプ、電子セ
ン光体および写真用フラッド電球がある。これら
のなかでもとりわけ水銀蒸気アーク、太陽ランプ
が好適である。ある場合には可視光線に露光して
もよい。この場合には可視光線に感受性のある光
開始剤を用いる必要がある。この光開始剤として
は例えば9・10-フエナンスレンキノンがある。
勿論、可視光線を有効に放射する線源を用いるこ
とはいうまでもない。上述の放射線源の多くは、
かかる可視光線の必要量を供給する。

露光後、光重合性組成物は、例えばスプレー
ジェットの衝突により、攪拌付の浸漬により、また
はブラッシング、スクラッピング等により現像さ
れる。この現像法のうちブラッシングとスクラッ
ピング法では、濃度0.01~10重量%のアルカ
リ水溶液を用いて所望の像に現像が行なわれる。

現像用の塩基としては、水酸化アルカリ金属、
即ちリチウム、ナトリウムおよびカリウムの水酸

12

化物;弱酸の塩基反応アルカリ金属塩即ちリチウ
ム、ナトリウムおよびカリウムの炭酸塩または重
炭酸塩;塩基性度約 1×10^{-6} 以上のアミン即
ちベンジル、ブチルおよびアリルアミン等の第1
アミン;第2アミン例えばジメチルアミン、ベン
ジルメチルアミン;第3アミン例えばトリメチル
アミン、トリエチルアミン;第1、第2、第3の
ヒドロキシルアミン例えばプロパノール、ジエタ
ノール、トリエタノールの各アミンおよび2-ア
ミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパン
ジオール;環式アミン例えばモルホリン、ピペラ
ジン、ピペリジン、ピリジン;ポリアミン例えば
ヒドラジン、エチレンおよびヘキサメチレンアミ
ン;水可溶性塩基性塩例えば上記各アミンの炭酸
塩ないしは重炭酸塩;アンモニウムヒドロキシド
およびテトラ置換アンモニウムヒドロキシド例え
ばテトラメチル、テトラエチル、トリメチル
ベンジル、およびトリメチルフエニルアンモニ
ウムヒドロキシド、スルホニウムヒドロキシド例
えばトリメチル、ジエチルメチル、ジメチル
ベンジルスルホニウムヒドロキシド、およびこれ
らの可溶性塩基性塩例えば炭酸塩、重炭酸塩およ
び硫化物;アルカリ金属リン酸塩およびピロリン
酸塩例えばリン酸カリウムまたはリン酸ナトリウ
ム、ピロリン酸ナトリウムまたはピロリン酸カリ
ウム;テトラ置換(好ましくは全アルキル)ホ
スホニウム、アルソニウムおよびスチボニウムヒ
ドロキシド例えばテトラメチルホスホニウムヒ
ドロキシドがある。

光重合した組成物は、もし所望なら、公知の独
占的ストリッピング処方である強アルカリの加熱
水溶液に浸漬することにより容易に除去できる。

本発明は、次の各実施例によつて更に詳しく説
明される。

35 実施例 1

次の溶液を1ミル厚さのポリエステルフィルム
上に塗布し、GE-1500ワットのドライヤー
の熱風流で20分間乾燥した。感受性層の乾燥後
の厚さは約1ミルであつた。乾燥層を1ミル厚さ
のポリエチレンフィルムで覆つた。

溶液Aは、本発明の組成を示し、溶液Bは比較
例を示す。

溶液A

13

- (a) 50%スチレン、20%メチルメタクリレート、10%エチルアクリレート、20%メタクリル酸からなる共重合体；粘度（40%のメチルエチルケトン溶液で測定）4500 cps 25℃ 4 0.0 %
- (b) エトキシ化ビスフェノール A アクリレート * 1 4.0 g
- (c) テトラエチレングリコールジアクリレート 7.0 g
- (d) ベンゾフェノン 2.25 g 10
- (e) 4・4'-ビス-(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン 0.30 g
- (f) ヒドロキノン 0.03 g
- (g) ベンゾトリアゾール 0.12 g 15
- (h) 染料 0.07 g
- (i) メチルエチルケトン 2 1 0.0 g

* SR-349, Startomer Industries 社のジエトキシ化化合物の商標名

溶液 B

- (a) 75%スチレン、25%メタクリル酸の共重合体；粘度（40%のメチルエチルケトン溶液で測定）1000 cps 4 0.0 g
- (b) トリメチロールプロパントリアクリレート 1 4.0 g
- (c) テトラエチレングリコールジアクリレート 7.0 g
- (d) トリエチレングリコールジアセテート 1.02 g
- (e) トリクレシルフォスフェート 2.28 g
- (f) ベンゾフェノン 2.25 g
- (g) 4・4'-ビス-(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン 0.30 g
- (h) 2・2'-メチレンビス-(4-エチル-6-tert-ブチルフェノール) 0.30 g 40
- (i) ベンゾトリアゾール 0.15 g
- (j) 染料 0.07 g

14

- (k) メチルエチルケトン 2 1 0.0 g

銅被覆エポキシガラスファイバー板をクレンザーでこすつて洗い、拭いた後、水で完全にすすぐ。

5. 次いで、20秒間、12%の塩酸水溶液に浸漬し水ですすぎ、空気流で乾燥する。

ポリエチレンカバーシートを除去し、綺麗な銅面と光重合性層が接するように、ポリエステル支持体を有する裸のレジスト被覆を横層する。接合に当つては、ゴム被覆ローラを用い、速度2フィート/分、121℃(250°F)、接点での圧力4.26 kg/cm²(3ポンド/in²)で行なつた。ポリエステルフィルムで覆われた銅被覆ボードを、400ワットの50アンペア水銀灯(距離12インチ)を用いて、30秒間高コントラスト透明膜を通して露光した。

ポリエステル(ポリエチレンテレフタレート)支持フィルムを引きはがし、露光したレジスト層を、少量の界面活性剤を含有する1%~1.5%の苛性ソーダ水溶液とトレイ中で攪拌し現像する。攪拌時間は、約1分である。攪拌後水洗する。この現像法は、溶液Aにもまた溶液Bにも満足のいくものであつた。

露光した銅の表面は、現像後ボードを20%の過硫酸アンモニウム浴に30秒間浸漬し、水洗しさらに20%の塩酸溶液に30秒間浸漬し、水ですすぎ、空気流で乾燥して、洗浄される。この洗浄されたボードを、55℃のピロリン酸銅メッキ浴中で、3.3アンペア/m²(30アンペア/ft²)で45分間メッキした。両レジストともに下地銅表面をピロリン酸銅メッキ浴の各成分から保護した。

2つの組成物間の主たる差異は、溶液Bが脆く可撓性の悪いフィルム形成性高分子結合剤を用いているため形成した感光性レジストフィルムに十分な可撓性を付与するために外部可塑剤(成分(c)(d)溶液B)を加える必要があるのに対し、溶液Aは、その共重合体が内部可塑性であり、よく改良されたフィルム形成材料である点である。この共重合体は、乾燥寛容度、保水性(フィルム粘着性)および静的負荷下のコールドフローまたはクリープ耐性が極めて優れていることである。

2つの溶液から形成されたフィルムの可撓性はサンドイッチ構造の帯状物からポリエチレンシー

15

トを除去し、ボール中につめ込みそれを取り出し引き伸ばす前述の試験法によつて測定された。

可撓性試験はまた強制対流炉中で10分間180°Fで乾燥した溶液A、Bからなるフィルムにも実施された。この試験法は、光重合性レジストフィルムの乾燥寛容度を決定するためのものである。良好な乾燥寛容度であることは、商業用レジストフィルムにとつて必要不可欠のことである。というのは、かかるレジストから作つた製品は、その可撓性が残存溶媒に影響されず、良好な貯蔵寿命を有するからである。

次の表は、溶液A、Bから形成した2つのフィルムが可撓性、表面粘着性、乾燥寛容度の点で重大な差異があることを示す。

表 A

組 成	通常の乾燥		特別の乾燥後	
	可撓性	表面粘着性	可撓性	表面粘着性
溶液A	良 好	低 い	良 好	低 い
溶液B	やや良	少し粘着	貧 弱	低 い

コールドフローまたは塑性クリープは乾燥レジストフィルムにとつて重要な問題である。乾燥したレジストフィルムは種々の長さおよび幅のロール巻きで販売されている。これらのロール巻きにはある程度の張力が掛けられる。それは層間の左重ねまたはすべりを減殺するためのものである。ところがこの張力が塑性クリープを誘発する。コールドフローの影響は、端の融解または連続層の端の融着である。この融着のためポリエステル基体から光重合性層を少し取り除かなくてはロール巻きを解くことができないし、また乾燥フィルムにピンホールや大きな不連続部を形成することになる。こうした現象の生じたレジストは、その剝離部に露光による重合が起らず、またプリント回路導体の切断がピンホール部で起り、消費者にとつて受容し難い欠点である。

コールドフローは、水溶液から形成する公知の乾燥レジストフィルムにおいて特に顕著である。その典型的な例が溶液B組成物である。その原因は、結合剤樹脂が連鎖セグメントを含有するカルボン酸の大きな割合（普通20～25%）を含む

16

ことである。これらのセグメントは、フィルムを脆くする。このフィルムは外部可塑剤により可撓性のあるものにされるが、一面表面粘着性が増すと共にひどいクリープ性に繋がる。溶液Aは可塑性成分が結合剤重合体の骨格の一部をなしているのかかる欠点を生じない。

前述のコールドフロー試験法を用いて、巻き上げ乾燥フィルムロールを貯蔵し実験した。この条件下では、溶液B組成物からなる厚さ2ミルの乾燥フォトレジストフィルムは、2週間で著しいコールドフローを示し、その巻きロールは1ヶ月の貯蔵で販売出来ないものになった。他方、溶液Aの塗布液から作られたフィルムは端の融解がなくまた7ヶ月の貯蔵によつても内部ピンホールの形成がなかった。

スウオード硬度テストを用いた結果を次に示す。

表 B

スウオード 硬 度

組 成	1 ミルフィルム	2 ミルフィルム
溶液A	16～18	10～12
溶液B	8～10	4～6

実験フィルムの写真を、既知の受容しうるコールドフロー特性を有するレジストフィルムの写真と比較した。溶液Aのフィルムは、溶液Bのフィルムに較べきわめて少ないワイヤ目盛を示した。これは溶液Aのフィルムでは端ににじみ出しがほとんどないことを示す。

実施例 2

次の組成物を作り、厚さ1ミルのポリエステルフィルムの上に塗布し、実施例1で記した方法により厚さ約1ミルになるまで乾燥し、ポリエチレンで被覆する。

溶液C

(a) 50%スチレン、20%メチルメタクリレート10%エチルアクリレート、20%メタクリル酸の共重合体；粘度（40%メチルエチルケトン溶液で測定）4500 cps

40.0 g

17

(b) トリメチロールプロパントリ アクリレート	1 3.3 3 g
(c) テトラエチレングリコールジ アクリレート	6.6 7 g
(d) ベンゾフェノン	2.2 5 g
(e) 4・4'-ビス-(ジメチルア ミノ)-ベンゾフェノン	0.3 0 g
(f) 2・2'-メチレン-ビス- (4-エチル-6-tert-ブ チルフェノール)	0.3 0 g
(g) ベンゾトリアゾール	0.1 0 g
(h) 染料	0.0 7 g
(i) メチルエチルケトン	2 1 0.0 g

銅被覆エポキシフアイバークラスボードを洗浄し、上述の組成物で積層する。対象ボードは、実施例1の溶液Bの組成物で作られたフィルムを積層したものである。各ボード共に実施例1で述べた方法により露光し、現像し、ピロリン酸銅浴中でメツキした。両レジストフィルム共に、加熱アルカリメツキ浴中ですばらしいメツキが行なわれた。

実施例2では新規なレジストフィルムの物理的性質が単量体成分によつてどう変わるかを示す。溶液Cはエトキシ化ビスフェノール-Aジアクリレート(溶液A)の代わりにトリメチロールプロパントリアクリレートを用いる。この変換は、光重合性レジストフィルムの可撓性および乾燥寛容度にはほとんど影響を及ぼさない。しかしながらスウオード硬度の点で表Cに示すように減殺している。

表 C
スウオード 硬 度

組 成	1 ミルフィルム	2 ミルフィルム
溶液A	1 6 ~ 1 8	1 0 ~ 1 2
溶液C	1 2 ~ 1 4	8 ~ 1 0

溶液Cの組成物から作られたロール巻きは、2ミルの厚さに塗布されたものであり、実施例1の方法によつてコールドフローがテストされた。その挙動は、溶液Bの組成物から作られたものより

18

も優れていた。

実施例 3

次の組成物を作り、ポリエステルフィルムの上に厚さ1ミルに塗布し、実施例1で述べた方法で厚さ約1ミルまで乾燥し、ポリエチレンで被覆した。

溶液D

(a) 4 0 % スチレン、5 % メチル メタクリレート 2 5 % エチルア クリレート、3 0 % メタクリル 酸の共重合体；粘度(4 0 % メ チルエチルケトン溶液で測定) 5 8 0 0 cps	4 0.0 g
(b) トリメチロールプロパントリ アクリレート	1 4.0 g
(c) テトラエチレングリコールジ アクリレート	7.0 g
(d) ベンゾフェノン	1.5 0 g
(e) 4・4'-ビス-(ジメチルア ミノ)-ベンゾフェノン	0.2 0 g
(f) 2・2'-メチレン-ビス- (4-エチル-6-tert-ブ チルフェノール)	0.3 0 g
(g) トリルトリアゾール	0.0 4 g
(h) ベンゾトリアゾール	0.1 2 g
(i) 染料	0.0 6 g
(j) メチルエチルケトン	2 1 0.0 g
(k) メチルセロソルブ	1 0.5 g

銅被覆エポキシフアイバークラスボードを洗浄し、上記のフィルムで積層し、実施例1の方法で露光した。フィルムの露光しない部分を、1.5%炭酸ナトリウム水溶液含有トレイ中で30~60秒攪拌して洗い流した。得られたボードを塩化第二鉄の45°ボーマ溶液でエッチングし、洗い、乾燥した。レジストを130°Fの3%苛性ソーダ液に2分浸漬して除去した。得られたボードは、良質のプリント回路ボードであつた。1ミルの感光性フィルムの可撓性と乾燥寛容度は良好でありスウオード硬度は12~14であつた。

実施例 4

銅被覆エポキシフアイバークラスボードを実施例1のように洗浄し、乾燥した。このボードに次

19

の溶液のレジストフィルムを1ミルの厚さで積層した。

溶液E

- | | |
|--|---------|
| (a) 4.75% スチレン、2.0% メチルメタクリレート、1.0% アクリロニトリル、2.25% メタクリル酸の共重合体；粘度（3.8% メチルエチルケトン溶液で測定）3700 cps | 40.0 g |
| (b) トリメチロールプロパントリアクリレート | 14.0 g |
| (c) テトラエチレングリコールジアクリレート | 7.0 g |
| (d) ベンゾフェノン | 2.25 g |
| (e) 4,4'-ビス-(ジメチルアミノ)-ベンゾフェノン | 0.30 g |
| (f) 2,2'-メチレン-ビス-(4-エチル-6-tert-ブチルフェノール) | 0.30 g |
| (g) ベンゾトリアゾール | 0.15 g |
| (h) 染料 | 0.07 g |
| (i) メチルエチルケトン | 210.0 g |

積層ボードに実施例1記載の化学的活性放射線を照射する。レジストフィルムの未露光部を、25%のリン酸ナトリウムと少量の界面活性剤を含む水溶液とボードとをトレイ中で1分攪拌し除去する。

1ミルの光感受性フィルムの可撓性と乾燥寛容度は良好であり、絶縁塗料の表面は粘着性がなくスウオード硬度は16~18であつた。

上記の2%リン酸三ナトリウムで現像したボードを更に実施例1のように洗浄し、55℃のピロリン酸銅メッキ浴中で45分、3.3アンペア/㎡（30アンペア/ft²）でメッキした。すばらしい結果が得られた。

実施例 5

実施例1の光重合性溶液Aを、亜鉛、マグネシウム、銅の各プリント板に被覆した。約1ミルの厚になるまで暖風で乾燥し、次いでポリビニルアルコールの稀薄溶液を塗布し、乾燥した。水溶性重合体は酸素に対する薄い保護膜を形成した。これらの反応し易い金属板は相当の間貯蔵可能となつた。

20

化学的活性灯に適当なネガを介して露光し、未露光感光性層と水溶性トップコートと同時に現像し、エッチング用金属板に仕上げた。光重合した像は金属プリント板の製造に通常用いられる強いエッチング工程に対してもすばらしい耐性を示した。これらのレジストは、通常のエッチング剤、即ち塩化第二鉄、硝酸、フィルム形成剤およびエッチングの形状をコントロールするため通常に添加されるパンキング剤により耐性を示した。

実施例 6

実施例5において水溶性重合体の代わりに保護層として1ミルのポリエステルフィルムを用いた以外は同様の実施を行なつた。化学的活性灯に露光した後、アルカリ水溶液で現像する前に保護層を除去した。実施例5のように光重合した像はプリント板の強いエッチングに対して著しい耐性を示した。

実施例 7

実施例1の溶液Aをポリエステルフィルムに1ミルの厚さで塗布し空気で乾燥し、1ミル厚さのポリエチレンフィルムで覆つた。これらのサンドイッチ三層構造のフィルムは、シートないしはロールの状態、ほとんど変化なく長時間貯蔵できた。使用に先立ちポリエチレンカバーフィルムを取り除き、感光層を実施例5の金属プレートに接合し、積層する。化学的活性灯に露光し、保護ポリエステル層を取り除き、アルカリ溶液中で現像する。実施例5のように光重合像はプリント板の強いエッチングに対しすばらしい耐性を示した。

実施例 8

実施例1の溶液Aを、実施例5、6、7に記したようにオフセット石版印刷の常法に従つて薄いアルミニウム板上に被覆する。化学的活性灯の露光、アルカリ溶液による現像を行なつた。光重合像は、インク受容体としてすばらしいものであつた。またすばらしい摩擦抵抗をも示した。この実施例のプレートは、オフセット石版印刷に良好な結果をもつて使用された。

実施例 9

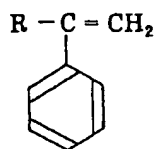
実施例1の溶液Aは、実施例5、6、7に示したように織布、メッシュ様基体の上に塗布された。化学的活性灯への露光、アルカリ水溶液による現像を行なつた。光重合像は、すばらしいマスクを示した。この応用は、絹のスクリーンプリントに

21

も有効である。

以下に本発明の実施態様を記す。

1. (A) 実質的に1ないしそれ以上の100℃以上の沸点を有する非ガス状化合物の実質的に1種またはそれ以上の附加重合性物質10～60重量部
(B) 光によりフリーラジカルを発生する附加重合開始剤系、および
(C) 40～90重量部のあらかじめ形成された巨大分子の高分子結合剤であつて、その重合体は、一般式



(式中Rは水素、炭素数1～6のアルキル基またはハロゲンである)

で表わされる群から選ばれた1またはそれ以上のスチレン型化合物またはそれらの環置換誘導体を含有する第1単量体物量と、

1またはそれ以上のアルキルアクリレート、アルキルメタクリレート、ヒドロキシアルキルアクリレートまたはヒドロキシアルキルメタクリレートの群から選ばれ、アルキル基は炭素数1～6、ヒドロキシアルキル基は炭素原子数2～6である化合物を含有する第2の単量体と、

1種またはそれ以上の炭素数3～15の α - β -不飽和カルボキシル基含有単量体を含有する第3の単量体物質

からなり、各単量体物質の割合は、結合剤を稀薄アルカリ水溶液に可溶性にする割合であり、しかも光重合性組成物が外部可塑剤の添加なしで可撓性を保持できる割合である事を特徴とする光重合性組成物。

2. 第1単量体物質がスチレンである第1項記載の光重合性組成物。
3. 第2単量体物質がメチルメタクリレートまたはエチルアクリレートまたはそれらの混合物である第1項記載の光重合性組成物。
4. 第3単量体物質がメタクリル酸である第1項記載の光重合性組成物。

22

5. 付加重合性物質が1またはそれ以上のポリオールの不飽和エステルである第1項記載の光重合性組成物。
6. 付加重合性物質がトリメチロールプロパン、トリアクリレートおよびテトラエチレングリコールジアクリレートである第1項記載の光重合性組成物。
7. 付加重合性物質がジエトキシル化ビスフェノールAジアクリレートおよびテトラエチレングリコールジアクリレートである第1項記載の光重合性組成物。

8. 次の各構成からなる積層体：

(A) 銅または銅合金からなる金属基体

(B) 沸点100℃以上の非ガス状の付加重合可能な化合物；フリーラジカル発生付加重重合開始剤系；および共重合成分の第1単量体がスチレン型物質であり、第2単量体がアクリレート型物質であり、第3単量体が、炭素原子数3～15を有する不飽和カルボキシル基含有単量体であつて、不飽和カルボキシル基含有単量体に対する各単量体の割合は生成した結合剤を稀薄アルカリ水溶液に可溶にし、かつ外部可塑剤なしで可撓性を付与する成分割合の共重合体からなる光重合可能な中間層、および

(C) 酸素不透過性の被覆層。

9. (A) 沸点100℃以上の非ガス状付加重合可能な物質；フリーラジカルを発生する付加重重合開始剤系、共重合体の第1単量体がスチレン型物質であり、第2単量体がアクリレート型物質であり、そして第3単量体が炭素原子数3～15である不飽和カルボキシル基含有単量体であつて、この共重合体成分の各単量体の不飽和カルボキシル基含有単量体に対する比が、光重合性組成物の可撓性が外部可塑剤なしで付与され、かつ前記各単量体から得られる結合剤を、稀薄なアルカリ水溶液に可溶性にする割合である、光重合可能な層を製造し、

(B) 前記の光重合可能な層を化学的活性光線に露光し、そして

(C) 稀薄アルカリ水溶液で前記層を洗浄し、光重合可能な層の未露光部を除去する

事より成る事を特徴とするフォトレジストの製

23

造法。

10. 光重合可能な層を基体に塗布し、光重合性層の未露光部分で被覆された基体の部分を洗浄により剝離することからなる第9項記載の方法。
11. 光重合性層を前記の洗浄を完了した後に、前記基体の非被覆部を永久的に変性するために光重合可能な層を処理する第10項記載の方法。
- 12(A) 1またはそれ以上のポリオールの不飽和エステルであつて、その沸点が100℃以上のもの10～60重量部の付加重合性物質。
- (B) 光開始でフリーラジカルを発生する付加重

24

合開始剤系、および

- (C) 共重合体成分がスチレン、メチルメタクリレート、エチルアクリレートおよびメタクリル酸であつて、その単量体割合が、結合剤を稀薄アルカリ水溶液に可溶性にし、かつ外部可塑剤なしで結合剤に可撓性が付与される割合である共重合体の40～90重量部のあらかじめ形成された巨大分子の高分子結合剤から成ることを特徴とする光重合性重合体。
- 10 13. 第1～8項記載の光重合性組成物を化学的活性線に露光することによつて得られる製品。